

## シリコン・ウェーハの 成膜加工サービス

# ケイ・エス・ ティ・ ワールド 株式会社



福井県  
福井市下六条町13-23

代表取締役  
川崎 正寛

1998年(平成10年)設立  
TEL 0776-41-7333

<http://www.kstworld.co.jp>

独自の厚膜熱酸化膜成膜技術で、高温の熱処理に強く、膜ストレスによる基板の反りの発生がない、膜厚25  $\mu\text{m}$ の熱酸化膜付きシリコン・ウェーハを製造。

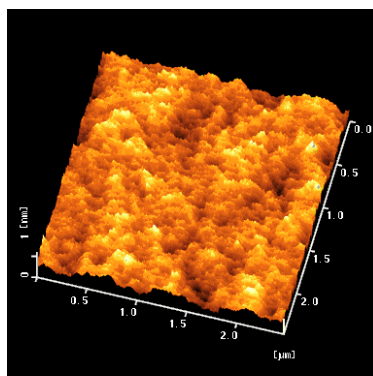
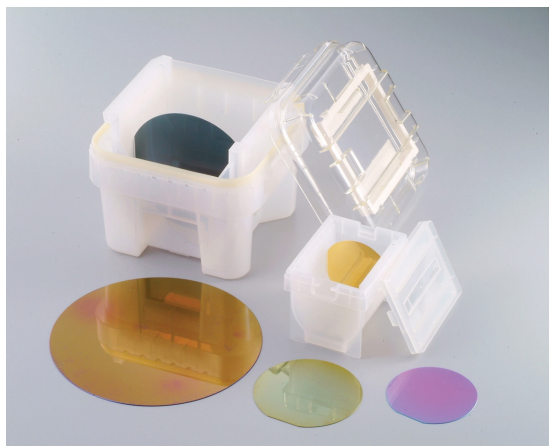
### 国内唯一の半導体・光通信用シリコン・ウェーハ成膜加工サービス専門メーカー

ケイ・エス・ティ・ワールド株式会社は、最先端のクラス10のクリーンルームや最新の製造設備装置・検査装置を導入した工場を有し、熱酸化の薄・厚膜形成処理を中心にあらゆる種類のシリコン・ウェーハ加工サービスを提供。特に同社の独自技術で開発された膜厚25  $\mu\text{m}$ の熱酸化膜付きシリコン・ウェーハやSOIウェーハは、世界中の半導体先端メーカーに出荷されている。

### 世界一の膜厚25 $\mu\text{m}$ の熱酸化膜付きシリコン・ウェーハ

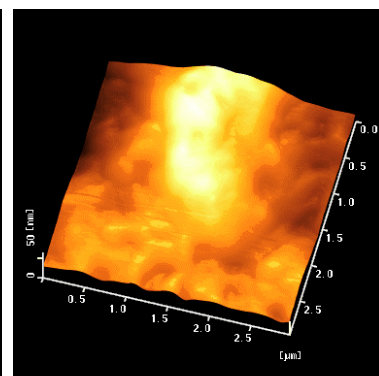
ケイ・エス・ティ・ワールド株式会社の独自技術である厚膜熱酸化膜成膜技術は、厚い膜が困難とされている「熱酸化法」によるシリコン・ウェーハ成膜加工技術で、光通信デバイス用シリコン・ウェーハとして国内外の大手メーカーに採用されている。

従来、同社の技術が確立されるまでは、CVD法や火炎堆積法で成膜されていた。同社の製品は、屈折率1.445~1.446を達成し、面内均一性は膜厚3%以下、屈折率 $\pm 0.0003$ 以下を実現し、高温の熱処理に強く、膜ストレスによる基板の反りの発生がない。その熱酸化膜の膜厚は最高25  $\mu\text{m}$ である。



ファイル名: 01426002.xqt  
コメント 1: Sample  
コメント 2:  
コメント 3:

20um熱酸化膜 表面AFM観察



ファイル名: 1p.xqt  
コメント 1: Sample  
コメント 2:  
コメント 3:

25um熱酸化膜 表面AFM観察